

トップインタビュー



代表取締役会長
東 哲郎

Question & Answer

代表取締役会長 東哲郎と
代表取締役社長 佐藤潔が、
今後の経営戦略、
市場動向などに関する
インタビューに答えます。



代表取締役社長
佐藤 潔

Q1: 最高収益を達成した2008年3月期を振り返っての評価をお聞かせください。

>> 当期は、これまで行ってきた様々な改革が大きく実を結んだ年となりました。

売上高9,061億円、営業利益1,685億円、当期純利益1,063億円といずれも新記録を達成しました。東京エレクトロンが約3年にわたる第1次中期計画を通して、粛々と進めてきた収益性向上のための施策が実を結び過去最高の収益と利益率を更新できたことは、評価に値すると思っています。

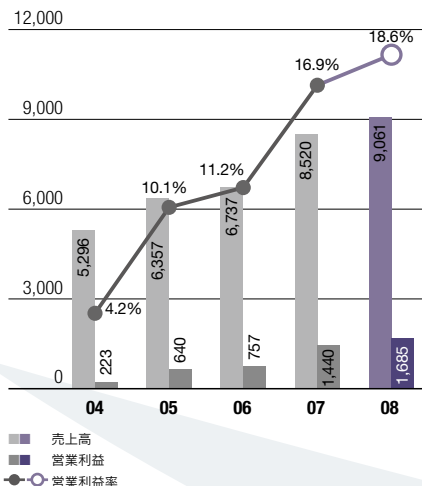
収益性の向上については、大きく2つの重点戦略が実を結びました。

1点目は「高付加価値をもつ新製品の創出」です。半導体製造プロセスが高度化し、顧客ニーズも多様化する中、高性能・高生産の製品を開発し、タイムリーに市場に投入してきました。前期はこれが量産体制に入ったことで、利益率の向上に大きく貢献しました。

2点目は「モノづくりの強化」です。開発、設計、調達、生産技術などすべての工程を見直すことにより、製造工程で発生するロスをなくす一方で、製造工期や製品納入後の立ち上げ期間の短縮も実現させました。また「品質の向上」により「無償保証コスト」と呼ばれる客先での追加費用を減少させるなど、コストダウンと顧客満足の両方を実現させることができました。

このような様々な改革により、営業利益率は18.6%と3年前に中間目標として設定した17.0%を大きく超えることができました。また、当社が継続的に取り組んできた重要課題の一つである「売上高に同期したキャッシュの創出」につきましても、運転資金需要の増大期にも関わらず、フリー・キャッシュ・フローが867億円と大きくプラスになりました。

売上高および営業利益
(億円)



注記：2005年3月期に収益計上基準の変更を始めとする会計方針の変更を行いました。詳しくは連結財務ハイライトの注記をご参照ください。

Q2: 半導体前工程製造装置のグローバル市場における東京エレクトロンのシェアがさらに拡大していますが、その要因は何でしょうか？

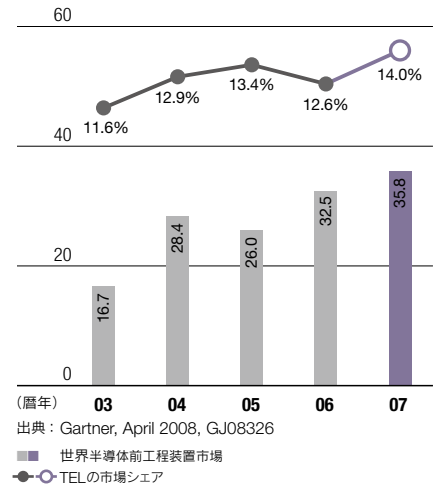
>> 顧客のニーズにあった新製品が、特に市場の成長が著しいアジア地域で広く受け入れられ、当社のシェアが拡大いたしました。

当期は大容量DRAMやNANDフラッシュメモリ生産のための最新鋭設備の投資が、日本を含めたアジア地域で活発に行われました。当社はアジアにおける顧客へのバックアップ力が大変強力であることに加えて、これまでに市場投入してきた製品が、高性能装置を求める顧客より高い評価を受けたことが、当社の成長を牽引したと考えます。

高度なプロセス性能と量産性能の両立が求められるメモリーメーカーから当社製品への需要が高まり、特にDRAMメーカーが集積する台湾における売上が前期比で約1.8倍ほどになりました。

世界半導体前工程製造装置市場とTELの市場シェア

(十億米ドル)



Q3: 2007年の秋頃から受注額に変化が見られますが、今後の市場動向をどのように考えられていますか？

>> 半導体製造装置市場は設備投資の谷間の年となりますが、FPD製造装置市場は大きなプラス成長を迎えようとしています。

メモリ製品への需要拡大期待から2007年に活発に行われた設備投資がメモリ需給バランスの悪化を引き起こし、2008年は設備投資の観点からは厳しい年となりそうです。しかし、コンシューマー向けの記憶媒体として今後DRAM、NANDフラッシュメモリはさらに市場を大きく牽引していくと思われますので、需給バランスの改善とともに顧客の設備投資動向はそう遠くない先に回復してくると期待しています。

一方、FPD製造装置市場は、デジタルテレビの需要拡大に向けて、液晶パネルメーカーによる大型基板向けを中心とした装置を中心に、積極的な設備投資が進められていますので、2008年後半から大きな成長の年に転じるでしょう。



Q4: それでは、次のシリコンサイクルのピークにおいて、さらに大きな成長を目指すために、どのような取り組みを行っていますか。

>> 次の成長期に飛躍するための布石となるプロセス開発、および新分野開拓のための研究開発の一層の強化を図るとともに、「モノづくり」力を向上させ最大生産効率の追求をしていきます。

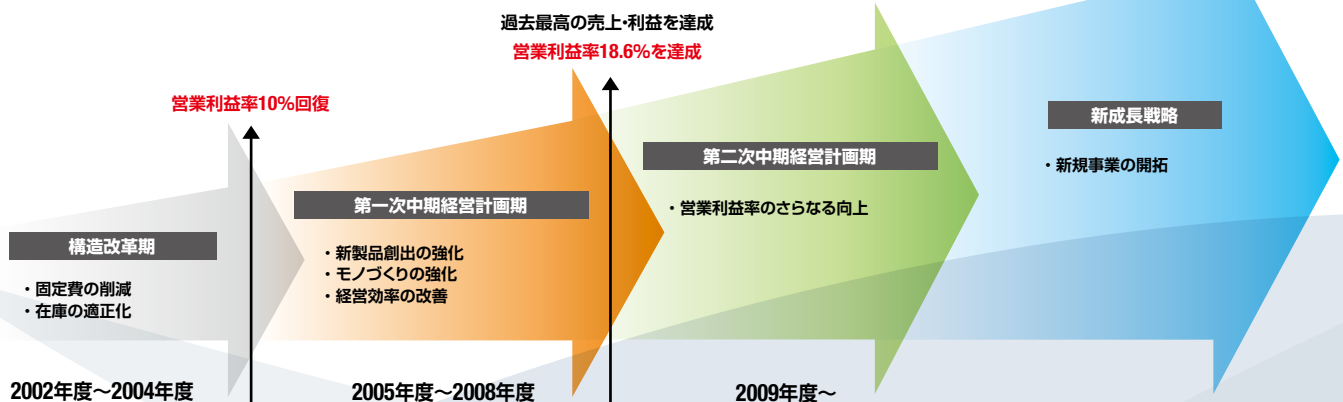
1つ目は、既存分野での成長です。顧客のさらなる微細化要求やデバイスの低消費電力化などに対応する技術を開発し、新製品として提供していきます。技術開発は、言うまでもなく成長の源泉となります。とりわけ半導体のプロセス開発に関しては、従来より顧客が開発の主体としてリーダー役を担ってきましたが、現在では多くの顧客が回路設計やソフト開発などに重点をシフトし、装置メーカーがプロセス開発の役割を分担して受けることを期待されています。当社は、この数年来、プロセス開発力を強化するよ

う転換を図り、一定の成果が出てきていますが、まだ十分ではないと考えています。このようなことから、中長期的な視点のもと、大学や研究開発機関と連携を一層強化するとともに、開発型プロセスエンジニアの強化を図ることが重要になります。

2つ目は、新規事業による規模の拡大です。主軸となる半導体製造装置およびFPD製造装置に加えて、環境・クリーンエネルギー分野においても、薄膜型太陽電池用CVD装置の事業化を推進させると



さらなる成長に向けて





ともに、省エネルギー化に貢献するSiCデバイス用にエピタキシャル膜成長装置による量産技術を確立させ、より高い品質と低コストのSiCデバイスの実用化を目指しています。また環境対応への装置改造ビジネスにも注力し、技術で環境問題に取り組みます。

3つ目は、生産改革の分野です。昨年8月に操業を開始した合志事業所の3号棟工場は、九州全域などに分散していた工場外生産現場を本工場に集めたことにより、トラック輸送や梱包・開封、搬入時の検査にかかっていた時間が不要になり、製造工期の短縮、物流コストの低減、品質向上に寄与しています。このような良い成果をグループ各社に広げていきます。

Q5: 新たな製造拠点として、宮城県に新工場の建設を予定されていますが、その事業計画についてお話しください。

>> エッチング装置市場は中・長期的に大きな拡大が見込まれます。現在分散している当社のエッチングビジネスの技術開発と製造の拠点を統合することで、さらなる事業規模の拡大と収益性の向上を目指しています。

今後も成長が見込まれている半導体製造装置市場で、特にエッチング装置市場は大きな伸びが予測されています。東京エレクトロンの主力製品の一つであるエッチング装置の開発・製造はこれまで複数の拠点で行ってきましたが、事業用地が手狭になってきたこともあり、宮城県の地に新拠点を構築し、エッチング装置事業の集約を進めていきます。

半導体製造装置業界は、技術革新のスピードが速く、新技術の開発が事業を左右するため、優秀な人材の確保が大変重要となります。宮城県にはすでに当社の活動拠点があることに加え、多くの学校があり優秀な人材の確保や産学連携による最先端技術の開発が可能となるなど、地域のバックアップにも期待をしています。

2010年の稼働開始を予定している新工場では、世界最高の品質を持つ装置を、さらに効率的に生産できる体制を確立させたいと考えています。技術開発から設計ならびに量産能力を集約した拠点を構築することで、技術競争力の確立と生産性の向上を目指しています。前述の九州工場で始めた取り組みを新工場でも展開させ、サプライヤーの参画を得た場内生産による工期短縮と物流コストの低減を図っていきます。また物流面での環境負荷を減らすのみならず、省エネルギー設計など環境問題に対する対策も積極的に取り入れていく構想です。新世紀型の拠点を足がかりとした、今後の事業拡大に、大いにご期待いただきたいと思えます。

Q6: 環境に対する取り組みについてお聞かせください。

>> 環境問題は重要な経営課題であると同時に、大きなビジネスチャンスでもあります。

地球規模での気候変動や温暖化の問題が非常に大きく取り上げられ、産業界では温暖化対策の具体化が求められています。このような中で、様々な施策や規制が草案されていますが、温暖化ガス削減や省エネルギーとして、具体的にこれを解決するのは技術革新によるものです。これを地球的要請に基づく大きなビジネスとして事業化していくことが、社会への大きな貢献につながるものと考えています。

当社ができる温暖化対策としては、まず製品において、いかに環境負荷の少ない装置を開発できるか、中でも消費電力の削減は大きな課題です。プロセスにおいて使用するガス、薬液、水の消費量の削減も重要です。さらに、当社の開発した装置やプロ

セスが、半導体およびディスプレイ自体の消費電力を大きく抑制できる性能を持つことが、社会に幅広く影響をもたらすと考えています。また、製品輸送についても検討の余地があると思います。航空機での輸送を船舶輸送に、トラックによる輸送距離の短縮化を実現できる工場立地など温暖化対策の課題が隠されています。





もう一つの大きな取り組みとしては、太陽電池製造装置市場を通じた地球温暖化問題への貢献です。クリーンな発電装置として「太陽電池」が注目され、大規模発電へ応用しようという動きが活発になっています。太陽電池は理想的な環境性能を持つことから、その生産設備の市場も長期にわたり高い成長が期待されています。2030年までには、火力発電並みの発電コストに低減していこうという目標から、技術的にも多くの革新が予想され、装置技術向上を目指して様々なチャンスがあります。

太陽電池用製造装置につきましては、これまで当社では基礎的な研究を多種行っておりましたが、2008年2月に太陽電池製造装置市場に参入することを発表し、薄膜シリコン太陽電池用プラズマCVD装置を製品化するにあたり、シャープ株式会社と合弁で開発に特化した新会社を設立しました。薄膜シリコン太陽電池は近年注目されている太陽電池の一つです。ガラス基板に薄膜のシリコン層を形成するタイプの太陽電池で、安価に製造でき、大量に普及する可能性を秘めた製品です。より生産性の高い薄膜シリコン太陽電池用プラズマCVD装置を開発し、2009年には完成品の出荷を開始していく予定です。

技術で環境問題に取り組む

企業の責任、使命、そして大きなビジネスチャンス



TEL装置の省エネルギー化を促進

省電力・高効率デバイスを作る製造装置の提供

クリーンエネルギー関連の製造装置の提供